วรินทร ชาตะรัตน์: การวิเคราะห์ขั้นสูงของฟิล์มทีเอ-คาร์บอนชนิดบางมาก สำหรับ ฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุสูง (ADVANCED CHARACTERIZATION OF ULTRA-THIN TETRAHEDRAL AMORPHOUS CARBON OVERCOATS FOR HIGH AREAL DENSITY MAGNETIC RECORDING) อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล, 145 หน้า.

คำสำคัญ: การบันทึกด้วยแม่เหล็กช่วยด้วยความร้อน/ คุณสมบัติทางไตรโบโลยี/ อัตราส่วน เ $_{
m D}/{
m I}_{
m G}$

เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลด้วยแม่เห<mark>ล็ก</mark>ในอนาคต เช่น การบันทึกด้วยแม่เหล็กช่วยด้วยความ ร้อน (HAMR) จะมีความจุหนาแน่นของพื้น<mark>ที่สูงขึ้น</mark>และความหนาของฟิล์มคาร์บอนที่บางลง ช่วยทำให้ ระยะห่างของหัวอ่านแผ่นดิสก์ (HMS) ลดลงเพื่อเพิ่มความจุ ดังนั้นจะทำให้ประสิทธิภาพของฟิล์ม คาร์บอนลดลงที่มีความจำเป็นในการปก<mark>ป้อ</mark>งหัวอ่า<mark>น</mark>และแผ่นดิสก์ ในวิทยานิพนธ์นี้ เตตระฮีดรัลฟิล์ม คาร์บอน (ta-C) บางเฉียบจำนวนมา<mark>กสำ</mark>หรับ**ฮา**ร์ด<mark>ดิส</mark>ก์โดรฟ์ (HDD) ถูกสังเคราะห์และตรวจสอบใน แง่ของคุณสมบัติทางไตรโบโลยี <mark>สภาพ</mark>แวดล้อม ในการยึดติดทางเคมี และโครงสร้างจุลภาคของ คาร์บอน การศึกษานี้แบ่งออกเป็<mark>นส</mark>องส่วน: (i) โครงสร้<mark>างค</mark>ล้ายเพชรของเตตระฮิดรัลฟิล์มคาร์บอนที่ บางเฉียบพึ่งพาความหนาของฟิล์ม สำหรับการบันทึกด้วยส<mark>น</mark>ามแม่เหล็กที่มีความหนาแน่นของพื้นที่ สูงและ (ii) อิทธิพลของค<mark>วา</mark>มห<mark>นาของขั้นอินเตอร์เลเยอร์ที่</mark>มีต่อโครงสร้างคล้ายเพชรของเตตระฮีดรัล ฟิล์มคาร์บอนที่บางเฉียบ <mark>เกี่ย</mark>วกับ (i) : ชั้นเคลือบบางเฉียบของเตตระฮีดรัลฟิล์มคาร์บอน ถกประดิษธ์ ์ ขึ้นในช่วงความหนาระหว่<mark>าง 0.5</mark> ถึง 5.0 นาโนเมตร บนชั้นซิลิ<mark>กอนอิ</mark>นเตอร์เลเยอร์ บนพื้นผิวของนิเกิล เฟอร์ไรต์ (NiFe) โดยใช้แบบ<mark>พัลส์ฟิลเตอร์แคโทดิกอาร์คในสุญญ</mark>ากาศ (PFCVA) เทคนิคโดยความหนา ของชั้นเคลือบเตตระฮีดรัลฟิล์มคาร์บอนถูกวัดความหนาของฟิล์ม โดยใช้ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องผ่านความละเอียดสูง (HRTEM) และเอ็กซ์เรย์เรื่องแสงกระจายคลื่น (WDXRF) และการ วิเคราะห์ชั้นผิวขั้นสูง เช่น AFM XPS NEXAFS และ Raman spectroscopy ระบุลักษณะทางสัณฐาน วิทยาของพื้นผิว องค์ประกอบทางเคมี และโครงสร้างของฟิล์ม วิเคราะห์สมบัติทางไตรโบโลยีด้วยการ สึกหรอแบบบอลไปกลับบนแผ่นดิสก์และ ความขรุขระของพื้นผิวของสารเคลือบ ถูกรายงานว่าต่ำกว่า 0.23 นาโนเมตร ชั้นเคลือบของเตตระฮีดรัลฟิล์มคาร์บอน แสดงสัดส่วนพันธะ sp³ C สูง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความหนาของฟิล์มลดลงมาในระดับ 1.0 นาโนเมตร สัดส่วนของพันธะ sp² ขยายตัว เพิ่ม สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (COF) อย่างมีนัยสำคัญ ผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดของความหนา ของเตตระฮีดรัลฟิล์มคาร์บอน ที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยพัลส์ฟิลเตอร์แคโทดิก-อาร์คในสุญญากาศเทคนิคเพื่อ เป็นสารเคลือบป้องกันสำหรับอุปกรณ์จัดเก็บแม่เหล็กความหนาแน่นสูง เกี่ยวกับ (ii) : การสปัตเตอร์ใช้ ในการเคลือบชั้นอินเตอร์เลเยอร์ชั้นซิลิกอนและซิลิกอนในไตรที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.0 นาโน เมตร ตามด้วยเคลือบ 1.0 นาโนเมตร ของเตตระสีดรัลฟิล์มคาร์บอน ด้วย พัลส์ฟิลเตอร์แคโทดิกอาร์ค

ในสุญญากาศ การทดสอบแบบ Ball-on-disk เปิดเผยว่า ซิลิกอน-คาร์บอน และซิลิกอนในไตร คาร์บอนจะมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (COF) ทีมีต่ำกว่า ฟิล์มไม่มีอินเตอร์เลเยอร์ จากการ วิเคราะห์ XPS เปิดเผยว่าพันธะ Si และ Si-N ถูกแปลงเป็นพันธะ Si-C และ C-N โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเคลือนชั้นอินเตอร์เลเยอร์ของซิลิกอนในไตร ระหว่างชั้นเต-ตระฮีดรัลฟิล์มคาร์บอน และนิเกิล เฟอร์ไรต์ (NiFe) ตามหลักฐานพบขั้นประสานที่ก่อตัวขึ้นระหว่างสองชั้นดังกล่าว ทำหน้าที่เป็นชั้นกั้น ป้องกันการอพยพของน้ำและออกซิเจนผ่านมายังเตตระฮีดรัลฟิล์มคาร์บอน จากพื้นผิวของนิเกิลเฟอร์ ไรต์ ซึ่งบ่งชี้ว่าเตตระฮีดรัลฟิล์มคาร์บอนแสดงองค์ประกอบออกซิเดชันที่ลดลงซึ่งสนับสนุนให้มีการยึด เกาะ ${\rm sp}^3$ C พิจารณาว่าความหนาและความได้เปรียบของ อินเตอร์เลเยอร์ของซิลิกอนในไตรมีส่วน ช่วยในการเพิ่มเนื้อหา ${\rm sp}^3$ C ได้ดีเพียงใด ซึ่งยืนยันการค้นพบของ Raman เกี่ยวกับอัตราส่วน ${\rm lp/l_G}$ ที่ ลดลง ตามความหนาของอินเตอร์เลเยอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการออกแบบระบบบันทึกแม่เหล็กความ หนาแน่นสูงด้วยสถาปัตยกรรมเตตระฮีดรัลฟิล์มคาร์บอนที่เหมาะสม



สาขาวิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2564 ลายมือชื่อนักศึกษา รภา ภาพ ภาพ ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รภา ภาพ ภาพ ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม กาต สามาก

WARINTORN CHATARAT: ADVANCED CHARACTERIZATION OF ULTRA-THIN TETRAHEDRAL AMORPHOUS CARBON OVERCOATS FOR HIGH AREAL DENSITY MAGNETIC RECORDING. THESIS ADVISOR: ASSOC. PROF. PRAYOON SONGSIRIRITTHIGUL, Ph.D. 145 PP.

Keyword: heat-assisted magnetic recording/ tribological properties/ I_D/I_G ratio

Tetrahedral amorphous carbon (ta-C) films is a class of diamond-like carbon films that contains a high fraction of tetrahedral sp³ bonded carbon in its structure. It has been commonly used as an overcoat to provide protection against corrosion and mechanical wear for magnetic recording device and hard disk drive (HDD) components, such as, sliders, read/write heads, and media. For this application, it is desirable to reduce the overcoat thickness as thin as possible, down to a few nanometers, in order to increase the density and capacity of magnetic recording devices and HDDs. However, as the thickness reaches the nanometer range, the ta-C overcoats may not be able to maintain their chemical bonding structure, especially their high sp³ bonds fraction, which directly associated with their mechanical properties, such as density, wear, corrosion, thermal stability, and hardness.

This thesis reports on a comprehensive study on chemical structures and tribological properties of ultrathin ta-C overcoats with thicknesses of between 0.5 and 5.0 nm for high areal density magnetic recording. The ta-C overcoats were fabricated on NiFe substrates using a pulsed filtered cathodic vacuum arc technique. The ta-C overcoat thicknesses were accurately determined by high-resolution transmission electron microscopy and wavelength dispersive X-ray fluorescence techniques (WDXRF). The surface morphology, chemical composition, microstructure, and tribological properties were systematically investigated by atomic force microscopy (AFM), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), near-edge X-ray absorption fine structure, Raman spectroscopy techniques, and a reciprocating wear test. The results showed that the surface morphologies of ta-C overcoats were atomically smooth with a root mean square surface roughness (R_q) below 0.23 nm. The ta-C overcoats had high sp³ bonds fraction. However, as the overcoat thickness was thinner than 1 nm, the ta-C bonds fraction suddenly increased resulting in a significant increase in the

coefficient of friction. The obtained results demonstrated the limitation of the thickness of the ta-C overcoat fabricated by the PFCVA technique as a protective coating for high-density magnetic storage devices.

In addition, the influence of interlayers on the structure and tribological properties of ultrathin ta-C overcoats were investigated. Two different interlayers, Si and SiN_x, with thicknesses of between 0.5 and 5.0 nm were applied to the interface between the substrate and overcoat layer with a thickness of 1 nm. This was achieved by sputtering technique. The fabricated ultrathin ta-C overcoats were characterized by WDXRF, AFM, XPS and Raman spectroscopy, and their tribolgical properties were investigated by the reciprocating wear test. The AFM result showed that the insertion of both Si and SiN_x interlayers slightly changed the R_q of the overcoat. The results showed that the insertion of Si or SiN_x interlayer enhanced the formation of sp³ bond and the sp³ bond fraction tended to increase with the interlayer thickness. The XPS result also revealed the presences of Si-C and Si-O-C bonds on the interfaces of both Si and SiN_x interlayer, which enhance the adhesion between the overcoat layer and substrate.

School of Physics Academic Year 2021

Advisor's Signature

Co-advisor's Signature

Co-advisor's Signature

Student's Signature _________ &m

JUNIAD